

2024 年 12 月 2 日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也
(コード:6920 東証プライム市場)
問合せ先 企画管理部 広報・IR グループ 花島 頼示
(TEL.045-478-7111)

新製品 EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS シリーズ「E320」を発表

【概 要】

レーザーテック株式会社は、次世代 EUV マスクブランクス欠陥管理と歩留まり向上に貢献する EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS シリーズ「E320」を製品化し、正式に受注を開始いたします。

【内 容】

レーザーテックは、長年にわたり EUV 光源を用いた検査技術の開発を行ってまいりました。現在、当社で販売している ABICS シリーズ「E120」は、位相欠陥に対する高い検出感度と欠陥座標精度により出荷検査や欠陥 Mitigation 技術に活用され、お客さまからの高い評価と信頼を得ております。

一方、半導体デバイスのさらなる微細化に向けた High NA EUV リソグラフィ実用化のための技術検討が進展しており、EUV マスクブランクスにおいては、より微小な位相欠陥の管理が必要となつてまいります。

このたび製品化した ABICS シリーズ「E320」は、新たに設計した高倍率シュバルツシルト光学系の採用と照明光学系の最適化によって、High NA EUV リソグラフィ世代に必要な欠陥検出感度と欠陥座標精度を実現いたしました。

レーザーテックは、今後もお客さまのご要望にお応えする独自のソリューション開発によって、品質改善、生産性向上および業界の発展に貢献してまいります。

【特 長】

- Actinic inspection ($\lambda=13.5\text{nm}$ の EUV 光源を採用)
- 反射多層膜(Mo/Si)内部の転写性位相欠陥を高感度に検出
- 40x 暗視野光学系による高感度かつ高速検査が可能
- 1500x 高倍率レビューによる欠陥座標の高精度測定が可能
- 明視野/暗視野レビューによる欠陥解析(欠陥分類や疑似欠陥判定など)

【用 途】

- 次世代 EUV マスクブランクス(Mo/Si 多層膜)の位相欠陥の検査
- EUV マスクブランクス欠陥のレビュー
- 欠陥 Mitigation のための高精度な位相欠陥座標の出力



EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS シリーズ「E320」

お問い合わせ先

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第1ソリューションセールス部 神山 弦一郎

TEL:045-478-7337

E-mail: sales@lasertec.co.jp